This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- ... TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(18)日本国於許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 经营出股公寓委员

特開平6~29367

(名)公開日 平成6年(1994)2月4日

(51) int CL. - 美別記号 庁内整理等号 拉術表示簡所 HO1L 21/68 8418-4M B01J 3/02 C 2 8 C 14/56 8520 - 4K C30B 25/18 9040-46

審査請求 未請求 武术項の配1(金 5 頁)

(21) 出職番号

特顯字4-179524

(22) 出頭目

平成4年(1992)7月7日

(71)出頭人 390001915

山形日本電気核式会社

山帝県山形市北町4丁日12番12号

(72) 克男者 松潭 和到

山形原山形市北町四丁目12番12号山形日本

着免除式公社内

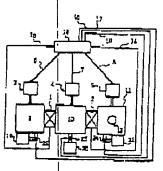
(70) 代理人 并即士 京本 直潜 (外2名)

(54) 【短明の名称】 | 東空楽層のパルブ制御方法

(67) 【要新》:

【目的】ロードロック宮、搬送鼠、処理歯がら構成され る真空装置でウェーハの頭面を行う麻、各部風間のパル ブを解けた時の圧力競によるごみの無い上がりを防止 し、ウェーハへのピみの付着を防ぐ。

【構成】例えば、外部よりパルプ制御13にV口[~! ェ関信号が入力されると、5mr6とStr7がそれぞ れの超走値以下であり、かつ、コロエ6とコモディが同 じであればパルプ制御部13よりSvmァーヒェ16を 出力する。Smェ6及びStェ7がそれぞれの形定位以 上であればエラー信号を思力し、5mェ6と5ェェアが 同じてなければ圧力が高いのは処理室9か拠送室10か の判定を行い、パルブ制御部13より伝力が高い部層の 郭気パルプ開信号Siviom 1.5 又はSiviol E.1 7の信号 が出力され処理図 8 又は概送図 1 0 の賞変排気が行われ る。SharfとStr7が同じになったらパルプ制画部 13よりSマホテーとに関信号15が出力される。



Philadel Band Revelop Bar -t-

1. DIELE-FESSEENHLYW.

/ noment

6 8:13EF ER

11ロードロック製工会会

上 引出到现代的现在分词 7 Mantineteeur

bene buyi apprehaus ar

· 64.2 a state

LIO PREFE

£ 24-11

4: *******

14: Vor-m 8/24 fino-m

は、佐田 大田田 ひきゅう

は: **出来の**なべたイを見すりませ で: 日本正サリアング目を多た。

ピ:ロードブック製具気がトア開発を入っ

9: ARRIGORASE

だ・他を見る中のエポンプ

21:0-700万里を開きますとす

SI: BASSESSAN PURREDDANT

2, u-10777888447



DERWENT TERMS AND CONDITIONS

Derwent shall not in any circumstances be liable or responsible for the completeness or accuracy of any Derwent translation and will not be liable for any direct, indirect, consequential or economic loss or loss of profit resulting directly or indirectly from the use of any translation by any customer.

Derwent Information Ltd. is part of The Thomson Corporation

Please visit our home page:

"WWW.DERWENT.CO.UK" (English)
"WWW.DERWENT.CO.JP" (Japanese)



MACHINE-ASSISTED TRANSLATION (MAT):

(19)【発行国】

日本国特許庁(JP)

(19)[ISSUINGCOUNTRY]

Japanese Patent Office (JP)

(12)【公報種別】

公開特許公報(A)

Laid-open (Kokai) patent application number

(A)

(11)【公開番号】

特開平6-29367

(11)[UNEXAMINEDPATENTNUMBER]

Unexamined Japanese Patent 6-29367

(43)【公開日】

平成6年(1994)2月4日

(43)[DATEOFFIRSTPUBLICATION]

February 4th, Heisei 6 (1994)

(54)【発明の名称】

真空装置のバルブ制御方法

(54)[TITLE]

The valve control method of a vacuum devices

(51)【国際特許分類第5版】

A 8418-4M H01L21/68 H01L 21/68

(51)[IPC]

A8418-4M

B01J 3/02

B01J 3/02 14/56 C23C14/56

8520-4K

C23C 8520-4K

C30B25/16 9040-4G

25/16

L

C30B 9040-4G

> 未請求 【審査請求】

[EXAMINATIONREQUEST] UNREQUESTED

【請求項の数】

[NUMBEROFCLAIMS] One

【全頁数】

[NUMBEROFPAGES] Five

(21)【出願番号】

(21)[APPLICATIONNUMBER]

特願平4-179524

Japanese Patent Application No. 4-179524

(22)【出願日】

(22)[DATEOFFILING]

平成4年(1992)7月7日 Heisei 4 (1992) July 7

(71)【出願人】

(71)[PATENTEE/ASSIGNEE]

【識別番号】

[IDCODE]

(C) DERWENT 02/07/18 1/16



390001915

390001915

【氏名又は名称】

山形日本電気株式会社

NEC Yamagata Ltd.

【住所又は居所】

[ADDRESS]

山形県山形市北町4丁目12番

12号

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 松浦 和則

MATSUURA KAZUNORI

【住所又は居所】

[ADDRESS]

山形県山形市北町四丁目12番 12号山形日本電気株式会社内

(74)【代理人】

(74)[PATENTAGENT]

【弁理士】

[PATENTATTORNEY]

【氏名又は名称】

京本 直樹 (外2名)

KYOMOTO NAOKI (et al.)

(57)【要約】

(57)[SUMMARY]

【目的】

[OBJECT]

ロードロック室、搬送室、処理 室から構成される真空装置でウェーハの加工を行う際、各部屋 間のバルブを開けた時の圧力差 によるごみの舞い上がりを防止 し、ウェーハへのごみの付着を 防ぐ。 In case a wafer is processed by the vacuum devices which consist of a load lock chamber, a conveyance chamber. The process chamber soaring of the refuse by the pressure difference when opening the valve between each chamber is prevented.

Adhesion of refuse to a wafer is prevented.

【構成】

[SUMMARY OF THE INVENTION]

例えば、外部よりバルブ制御1 3にVmr-tr開信号が入力 されると、Smr6とStr7 If a Vmr-tr opening signal is input into a valve control 13 from the exterior for example, when Smr6 and Str7 are below each designation value and Str7 are the same as Smr6, Svmr-

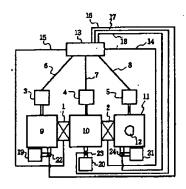


がそれぞれの指定値以下であ り、かつ、Smr6とStr7 が同じであればバルブ制御部1 3よりSvmr-tr15を出 力する。Smr6及びStr7 がそれぞれの指定値以上であれ ばエラー信号を出力し、Smr 6とStr7が同じでなければ 圧力が高いのは処理室9か搬送 室10かの判定を行い、バルブ 制御部13より圧力が高い部屋 の排気バルブ開信号Svom1 6又はSvot17の信号が出 力され処理室9又は搬送室10 の真空排気が行われる。Smr 6とStr7が同じになったら バルブ制御部13よりSvmr - t r 開信号15が出力され る。

tr15 will be output from the valve control part 13. An error signal will be output if Smr6 and Str7 are beyond each designation value.

If Str7 are not the same as Smr6, the evaluation that the thing with a high pressure is in the process chamber 9 or the conveyance chamber 10 will be performed. The signal of exhaust valve opening signal Svom16 or Svot17 of the chamber where a pressure is higher than the valve control part 13 is output, and the evacuation of the process chamber 9 or the conveyance chamber 10 is performed.

If Smr6 and Str7 become equally, the Svmr-tr opening signal 15 will be output from the valve control part 13.



1:処理官と豊政定員のパルプマロマーセ

- D----

2:単元なとロードロック全民のパンプ Ptr-ロ

9:如理直文空针

4:登美国英空计

5:ロードロック宣真型計

6: 处理家美空計の自力信号 Saur

7:最後展集空計の日力信号Str 8:ローアロック集空計の日か信号Str

8: 仮程室

10: 憲法章

11:ロードロック室

12: 7=-1

は、パルブは有部

M:Ve-a Rid Sha-a

: Vt-11 BBS but-11

15 : Vine - to 1985 3-eer - tr

LB:民党全計名パルプ開目号 Seem. LT:撤退全計名パルプ目目号 Seet.

18:ロードロック主要気パルプ回信令 Sec

D: 長理学真空景化ポンプ

20:独独全英空委仏ギンブ

21:ロードロック宝真空景気ギンブ

23:処理主導力(ロップ

23:他別定決定パルブ 24:ロードロッタ定義をパルブ

1. Valve between process chamber and conveyance chamber

Vmr-tr



- 2. Valve of conveyance chamber and load lock space Vtr-rr
- 3. Process chamber vacuum gauge
- 4. Conveyance chamber vacuum gauge
- 5. Load lock chamber vacuum gauge
- 6. Output signal Smr of process chamber vacuum gauge
- 7. Output signal Str of conveyance chamber vacuum gauge
- 8. Output signal of load lock vacuum-chamber meter Srr
- 9. Process chamber
- 10. Conveyance chamber
- 11. Load lock chamber
- 12. Wafer
- 13. Valve control part
- 14. Vtr-rr opening-signal Svtr-rr
- 15. Vmr-tr opening-signal Svmr-tr
- 16. Process chamber exhaust valve opening signal Svom
- 17. Conveyance chamber exhaust valve opening signal Svot
- 18. Load lock chamber exhaust valve opening signal Svor
- 19. Process chamber evacuation pump
- 20. Conveyance chamber evacuation pump
- 21. Load lock chamber evacuation pump
- 22. Process chamber exhaust valve
- 23. Conveyance chamber exhaust valve
- 24. Load lock chamber exhaust valve

【特許請求の範囲】

[CLAIMS]

【請求項1】

真空を用いる半導体製造装置で ロードロック室、搬送室、処理 室の各部屋の間に設けられたバルブを制御する真空装置のバルブを制御する真空装置配が ブ制御方法において、前部屋の圧力を比較し、どの部屋の 圧力が高いかを判定し、この場 定結果により圧力が高の信号を出 するがある部屋の圧力を同じ がある部屋の圧力を同じ

[CLAIM 1]

In the valve control method of the vacuum devices which controls the valve provided between each chamber of a load lock chamber, a conveyance chamber, and a process chamber by the semiconductor manufacturing apparatus using a vacuum,

The pressure of each above-mentioned chamber is compared and it judges whether the pressure of which chamber is high. By this judgment result, the signal for opening the exhaust valve of the chamber where a pressure



にして前記各部屋間のバルブを is high is output. 開く事を特徴とする真空装置の バルブ制御方法。

The pressure of a phase adjoining chamber is carried out equally, and the valve between each above-mentioned chamber is opened. The valve control method of the vacuum devices characterized by the above.

【発明の詳細な説明】

[DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION]

[0001]

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は半導体装置の加工を真 空中で行う半導体製造装置にお いて、ロードロック室, 搬送室, 処理室から構成される真空装置 の各部屋間のバルブを開く際の 真空装置のバルブ制御方法に関 する。

[INDUSTRIAL APPLICATION]

invention. the semiconductor This in manufacturing apparatus which processes a semiconductor device in a vacuum,

It is related with the valve control method of the vacuum devices at the time of opening the valve between each chamber of the vacuum devices which consists of a load lock chamber, a conveyance chamber, and a process chamber.

[0002]

[0002]

【従来の技術】

従来のロードロック室, 搬送室, 処理室から構成される真空装置 のバルブを開く際の制御方法 を、図3のブロック図、図4 (a), (b) の流れ図を参照し て説明する。

[PRIOR ART]

The control method at the time of opening the valve of the vacuum devices which consists of a conventional load lock chamber, a conveyance chamber, and a process chamber is demonstrated with reference to the block diagram of Figure 3, the flow chart of Figure 4 (a), and (b).

[0003]

ロードロック室11内のウェー ハ12は搬送室10を通り処理 室9に搬送される。この際ウェ ーハ12がロードロック室11 から搬送室10に搬送される 時、搬送室とロードロック室間 のバルブVtr-rr2 (以下 Vtr-rr2と称す)が開け

[0003]

The wafer 12 in a load lock chamber 11 is conveyed by the process chamber 9 through the conveyance chamber 10.

In this case when a wafer 12 is conveyed by the conveyance chamber 10 from a load lock chamber 11, valve Vtr-rr2 (Vtr-rr2 below this) between a conveyance chamber and a load lock chamber is opened.

Moreover, when a wafer 2 is conveyed by the



られる。又、ウェーハ2が搬送 室10から処理室9に搬送され る時、処理室と搬送室間のVm r-tr1(以下Vmr-tr 1と称す)が開けられる。 process chamber 9 from the conveyance chamber 10, Vmr-tr1 (Vmr-tr1 below this) between a process chamber and a conveyance chamber is opened.

[0004]

[0005]

上述した方法では、処理室9, 搬送室10,ロードロック室1 1間の圧力が指定値以下であれば、同じ圧力でなくともVmr ーtrl,Vtrーrr2が開く様な制御方法である為、各室間で気体の出入りが生じ、各部屋に存在する微小なごみが舞い上がる。

[0006]

【発明が解決しようとする課 題】

上述した従来のロードロック室,搬送室,処理室間のバルブの制御方法では、各部屋間の圧力に差が生じていても指定された圧力以下であれば各部屋間の

[0004]

As for control which opens Vmr-tr1 in this case, if a Vmr-tr opening signal is input into the valve control part 13 from the exterior If the vacuum gauge output signals Smr6 and Str7 are below each designation value, Svmr-tr15 will be output from the valve control part 13.

An error signal will be output if Smr6 and Str7 are beyond each designation value.

The control which opens Vtr-rr2 is performed similarly.

[0005]

In the method mentioned the above, if the pressure between the process chamber 9, the conveyance chamber 10, and the load lock chamber 11 is below designation value, even when it is not the same pressure, it is the control method which Vmr-tr1,Vtr-rr2 opens. For the reason, a gaseous coming in and out is generated between each chamber, and micro comfort which exists in each chamber soars.

[0006]

[PROBLEM ADDRESSED]

By the control method of the valve between the conventional load lock chambers mentioned the above, a conveyance chamber, and a process chamber, if it is below the designated pressure even when the difference has arisen to the pressure between each chamber, the valve between each chamber will open.



バルブが開く。この際圧力差に よりロードロック室と搬送室又 は搬送室と処理室との間に気体 の出入りが生じ、各部屋に存在 する微小なごみが舞い上がりウ ェーハに付着するという問題点 があった。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のロードロック室,搬送室,処理室からなる真空装置の各部屋間のバルブを開けるる際は、各部屋の圧力を開け、どの部屋の圧力が高にしたの判定し、がある部屋の圧力を開くある部屋間のバルブを開くようにしたものである。

[0008]

【実施例】

次に本発明について図面を参照 して説明する。図1は本発明の 一実施例のブロック図、図2 (a),(b)は流れ図である。

[0009]

ロードロック室11内のウェーハ12は搬送室10を通り処理室9に搬送される。この際ウェーハ12がロードロック室11から搬送室10に搬送される時、Vtr-rr2が開けられる。又、ウェーハ12が搬送室10から処理室9に搬送される時Vmr-tr1が開けられ

In this case, a gaseous coming in and out is generated between a load lock chamber, a conveyance chamber or a conveyance chamber, and a process chamber by the pressure difference. Micro comfort which exists in each chamber soared, and there was a problem of having adhered to a wafer.

[0007]

[SOLUTION OF THE INVENTION]

The control method at the time of opening the valve between each chamber of the vacuum devices which consists of the load lock chamber of this invention, a conveyance chamber, a process chamber and the pressure of each chamber is compared, it judges whether the pressure of which chamber is high, and the signal for this judgment result opening an exhaust valve is output.

The pressure of a next chamber is carried out equally and the valve between each abovementioned chamber was opened.

[8000]

[Example]

Next this invention is demonstrated with reference to a drawing.

Figure 1 is a block diagram of one example of this invention. Figure 2(a) and (b) are flow charts.

[0009]

The wafer 12 in a load lock chamber 11 is conveyed by the process chamber 9 through the conveyance chamber 10.

In this case Vtr-rr2 is opened when a wafer 12 is conveyed by the conveyance chamber 10 from a load lock chamber 11.

Moreover, Vmr-tr1 is opened when a wafer 12 is conveyed by the process chamber 9 from the conveyance chamber 10.



る。

[0010]

この際、Vmr-tr1を開く 制御は、外部よりバルブ制御部 13CVmr-tr1の開信号 が入力されると、真空計出力信 号Smr6及びStr7がそれ ぞれの指定値以下でありかつSmr6とStr7が同じであり mr6とStr7が同じであれ ばバルブ制御部13より開信号 Svmr-tr15を出力する。

[0011]

Smr6及びStr7がそれぞ れの指定値以上であればエラー 信号を出し、Smr6とStr 7が同じでなければ圧力が高い のは処理室9か搬送室10かの 判定を行い、バルブ制御部13 より圧力が高い部屋の排気バル ブ開信号Svom16又はSv o t 1 7 の信号が処理室排気バ ルブ22又は搬送室排気バルブ 23~出力され。処理室9又は 搬送室10の真空排気が行われ る。Smr6とStr7が同じ になったらバルブ制御部13よ り開信号Svmr-tr15が 出力される。Vtr-rr2を 開く制御についても同様に行わ れるものとする。

[0012]

【発明の効果】

以上説明したように本発明は、 ロードロック室, 搬送室, 処理 室間の圧力を比較し、同じであ った場合又は差が生じていた場

[0010]

In this case, as for a control which opens Vmr-tr1, if the opening signal of Vmr-tr1 is input into the valve control part 13 from the exterior, the vacuum-gauge output signals Smr6 and Str7 are below each designation value. If Str7 are the same as Smr6, opening-signal Svmr-tr15 will be output from the valve control part 13.

[0011]

An error signal will be taken out if Smr6 and Str7 are beyond each designation value.

If Str7 are not the same as Smr6, a judgment called the process chamber 9 or the conveyance chamber 10 by the thing with a high pressure will be performed. The signal of exhaust valve opening signal Svom16 or Svot17 of the chamber where a pressure is higher than the valve control part 13 is output to the process chamber exhaust valve 22 or the conveyance chamber exhaust valve 23.

The evacuation of the process chamber 9 or the conveyance chamber 10 is performed.

If Smr6 and Str7 become equally, opening signal Svmr-tr15 will be output from the valve control part 13.

It shall be similarly carried out about a control which opens Vtr-rr2.

[0012]

[EFFECT OF THE INVENTION]

As explained above, this invention compares the pressure between a load lock chamber, a conveyance chamber, and a process chamber. When the same, or when the difference has arisen, it judges whether the pressure of which



合はどの部屋の圧力が高いかを 判定し、判定の結果圧力が高い 部屋の真空引きを行い、圧力が 同じになった時点で各部屋間の バブを開く事により各部屋間の 気体の出入りをなくし、各部屋 に存在する微小なごみの舞い上 がりを防止しウェーハへの付着 を防ぐことができる。

[0013]

又、従来のバルブ制御方法では 100個程度のごみの付着があったのに対し、本発明のバルブ 制御方法では30個程度に低減 する事が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施例を説明するブロック図である。

【図2】

本発明の一実施例を示す図で、 同図 (a), (b) はそれぞれ流 れ図である。

【図3】

従来のバルブ制御方法を説明す るブロック図である。

【図4】

従来のバルブ制御方法を示す図で、同図(a),(b)はそれぞれ流れ図である。

【符号の説明】

1 処理室と搬送室間のバルブVmr-tr

2 搬送室とロードロック空間のバルブVtrーrr

chamber is high.

Vacuum suction of the chamber where a pressure is high is performed as a result of an evaluation. The coming in and out of the gas between each chamber is eliminated by opening the valve between each chamber by the point in time which the pressure became equally. Soaring of the micro comfort which exists in each chamber can be prevented, and adhesion to a wafer can be prevented.

[0013]

Moreover, there was adhesion of about 100 refuse by the conventional valve control method. By the valve control method of this invention, it can reduce to about 30 pieces to it.

[BRIEF EXPLANATION OF DRAWINGS]

[FIGURE 1]

It is a block diagram explaining one example of this invention.

[FIGURE 2]

It is the figure showing one example of this invention and said figure (a) and (b) are each flow charts.

[FIGURE 3]

It is a block diagram explaining the conventional valve control method.

[FIGURE 4]

It is the figure showing the conventional valve control method and said figure (a) and (b) are each flow charts.

[EXPLANATION OF DRAWING]

1 Valve between process chamber and conveyance chamber Vmr-tr

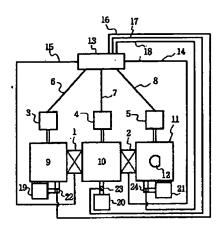
2 Valve of conveyance chamber and load lock space Vtr-m



【図1】

[FIGURE 1]





1: 及理金と登送室間のパルプ Vmm-tr 13: パルブ動物部

2: 数法室とロードロック意間のパルプ Vm-rr 14: Vm-rr 回信号 Svtr-rr 15: Vmm-tr 時信号 Svtm-tr 15: Vmm-tr 時信号 Svtm-tr 15: Vmm-tr 時信号 Svtm-tr 15: 处理金典交計 15: 処理金典交計 17: 最近金典文計 ルブ間信号 Svtm 17: 最近金典文計の成力信号 Smr 18: ロードロック室兼気パルブ間信号 Svtm 18: ロードロック室兼気パルブ間信号 Svtm 19: 処理室真交計気パルブ間信号 Svtm 19: 処理室真交計気パルブ間信号 Svtm 19: 処理室真交計気パルブ間信号 Svtm 19: 処理室真交計気ポンプ 11: ロードロック写真物味気点ンプ 11: ロードロック写真物味気点ンプ

 9: 払現金
 21: ロードロック直貨空跡気ポンプ

 10: 撤送室
 22: 及便全路気パルプ

 11: ロードロック室
 23: 最大空路気パルプ

 12: ウェーハ
 24: ロードロック室跡気パルプ

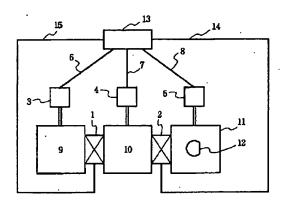
- 1. Valve between process chamber and conveyance chamber Vmr-tr
- 2. Valve of conveyance chamber and load lock space Vtr-rr
- 3. Process chamber vacuum gauge
- 4. Conveyance chamber vacuum gauge
- 5. Load lock chamber vacuum gauge
- 6. Output signal Smr of process chamber vacuum gauge
- 7. Output signal Str of conveyance chamber vacuum gauge
- 8. Output signal of load lock vacuum-chamber meter Srr
- 9. Process chamber
- 10. Conveyance chamber
- 11. Load lock chamber
- 12. Wafer
- 13. Valve control part
- 14. Vtr-rr opening-signal Svtr-rr
- 15. Vmr-tr opening-signal Svmr-tr
- 16. Process chamber exhaust valve opening signal Svom
- 17. Conveyance chamber exhaust valve opening-signal Svot



- 18. Load lock chamber exhaust valve opening-signal Svor
- 19. Process chamber evacuation pump
- 20. Conveyance chamber evacuation pump
- 21. Load lock chamber evacuation pump
- 22. Process chamber exhaust valve
- 23. Conveyance chamber exhaust valve
- 24. Load lock chamber exhaust valve

[図3]

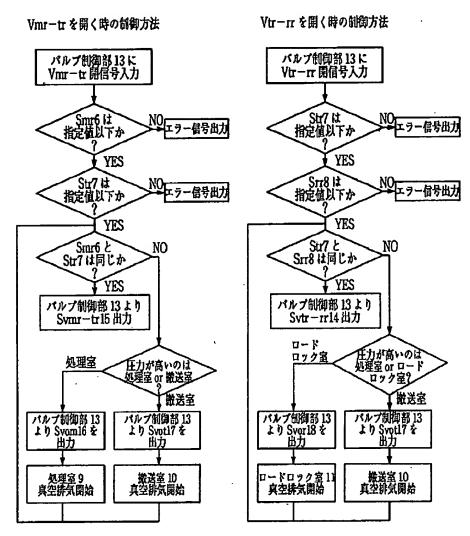
[FIGURE 3]



【図2】

[FIGURE 2]





(Up-down, left-right)

(a)

Control method to open Vmr-tr

(a)

Opening signal Vmr-tr is input to valve control part13

Is Smr6 below designation value?

No -> Error signal output

Is Str7 below designation value?

No -> Error signal output

Is Smr6 is the same as Str7?

(b)



Svmr-rr1 is output from valve control part13

Process chamber

Which pressure is higher; process chamber or conveyance chamber

Conveyance chamber

Svom16 is output from valve control 13

Svot17 is output from valve control 13

Process chamber 9 Evacuation starts

Conveyance chamber 1 Evacuation starts

(b)

Control method to open Vtr-rr

Opening signal Vtr-rr is input to valve control part13

Is Smr7 below designation value?

No -> Error signal output

Is Str8 below designation value?

No -> Error signal output

Is Smr7 is the same as Str8?

Svtr-rr14 is output from valve control part13

Load lock chamber

Which pressure is higher; process chamber or load lock chamber?

Conveyance chamber

Svor18 is output from valve control 13

Svot17 is output from valve control 13

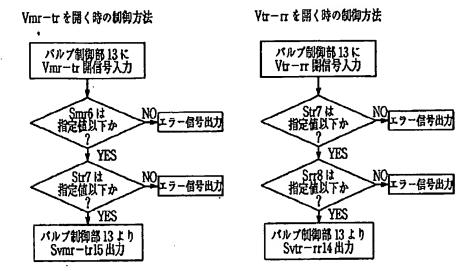
Load lock chamber 9 Evacuation starts

Conveyance chamber 1 Evacuation starts

【図4】

[FIGURE 4]





(b)

(Up-down, left-right)

(a)

(a)

Control method to open Vmr-tr

Opening signal Vmr-tr is input to valve control part 13

Is Smr6 below designation value?

No -> Error signal output

Is Str7 below designation value?

No -> Error signal output

Is Smr6 is the same as Str7?

Svmr-tr15 is output from valve control part13

(b)

Control method to open Vtr-rr

Opening signal Vmr-rr is input to valve control part13

Is Str7 below designation value?

No -> Error signal output

Is Srr8 below designation value?

No -> Error signal output

Is Srr7 is the same as Str8?

Svtr-rr14 is output from valve control part13